

電子ビーム露光実践セミナー

文部科学省委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として、「電子ビームリソグラフィ実践セミナー」を産業技術総合研究所つくば中央にて開催いたします。電子ビーム露光技術の基礎を初心者にも分かり易く解説するとともに、電子ビーム露光装置メーカー各社から最新の露光装置の性能と事例を紹介いたします。また、各セッションの終わりにオーサーズ・インタビューの時間を設けました。普段質問しづらいことを、この機会に是非、講師の先生方に個別にご質問ください。

また、このセミナーへの参加をより充実した機会にするために、無料実習コースを併設しています。产学研官にかかわらず、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

【講演】

【日時】平成29年2月21日(火)12:55-17:00

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内／申し込み】

<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h28-4/profile/index.html>

【講演プログラム】

12:55-13:00 開会

産業技術総合研究所 共用施設ステーション 多田 哲也

13:00-14:00 『電子線露光の基礎』

東京工業大学 宮本 恭幸

14:00-14:20 『グラフェン評価のための電極形成プロセス』

産業技術総合研究所 佐藤 平道

14:20-14:40 休憩(オーサーズ・インタビュー)

14:40-15:10 『電子ビーム描画装置の高度な使い方』

日本電子株式会社 會田 征徳

15:10-15:40 『電子線描画装置の課題と開発計画について

～高精度と高スループット達成の為の新技術～』

株式会社エリオニクス 新関 崇

15:40-16:10 『F7000Sの最新露光事例紹介』

株式会社アドバンテスト 瀧澤 昌弘

16:10-16:40 『クレスティックの電子ビーム描画装置』

株式会社クレスティック 柴田 政宏

16:40-17:00 オーサーズ・インタビュー

17:00 閉会

実習プログラム1

【日時】2017年3月8日、9日

【場所】東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

【実習内容】日本電子株式会社製JBX-6300SJを用いて近接効果補正に関する実習を行う

【定員】1日に付2名、2回実施

実習プログラム2

【日時】後日決定(2月・3月末の2日間)

【場所】国立研究開発法人産業技術総合研究所

【実習内容】クレスティック社製CABL-9410TFNAを用いて電子ビーム露光に関する実習を行う

【定員】2名

※実習コースを受講される方は、講義を受講している必要があります。

主催:産業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)

主催:東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

共催:ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール:tia-npf-school4@aist.go.jp

